

Aka-Brief #10 材料: 50-150HV

1						
	Rhaco Grit P320	水	300 RPM	20 N	磨平	
2						
	Largan 9	DiaUltra 9 μm	150 RPM	30 N	4 min	
3						
	Daran	DiaUltra 3 μm	150 RPM	25 N	3 min - 5 min	
4						
	Chemal*	Colloidal Silica 50 nm Alkaline**	150 RPM	15 N	1 min - 2 min	

图中所示时间与压力均适用于标准的300毫米制样系统和40毫米直径样品。

使用250毫米制样系统时，时间相应增加30%；使用200毫米制样系统时，时间相应增加 100%。

所使用的压力应随样品尺寸的增大和减小而进行相应的增大和减小。

样品夹/样品移动盘的转速为150转/分钟。

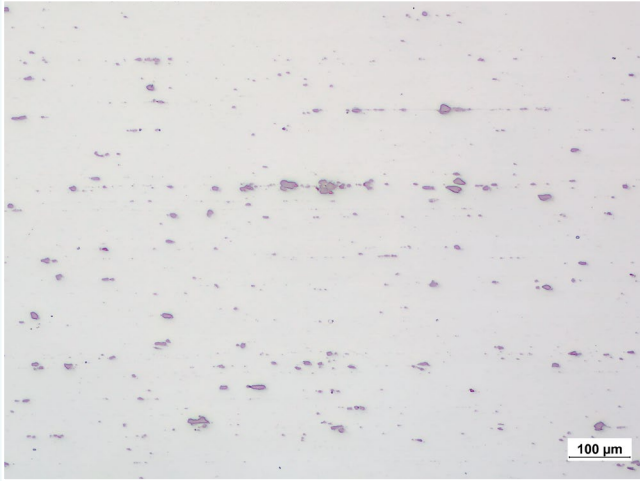
样品制备所需的时间和压力可能根据制样设备的不同而有所变化。

*开始氧化抛光之前，加水使整片抛光布湿透，样品夹/样品移动盘下移接触到抛光布时，停止加水。在氧化抛光的最后10秒，加水冲洗样品和抛光布。

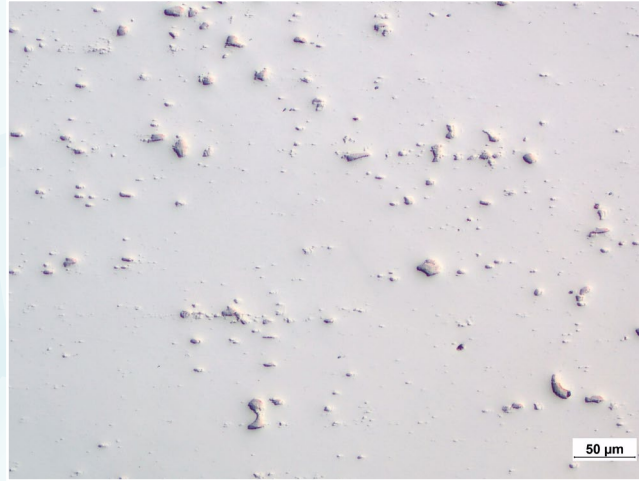
**制备某些材料时，可能需要添加添加剂，请查阅我们的氧化物抛光手册获取更多信息。

Aka-Brief #10 材料: 50-150HV

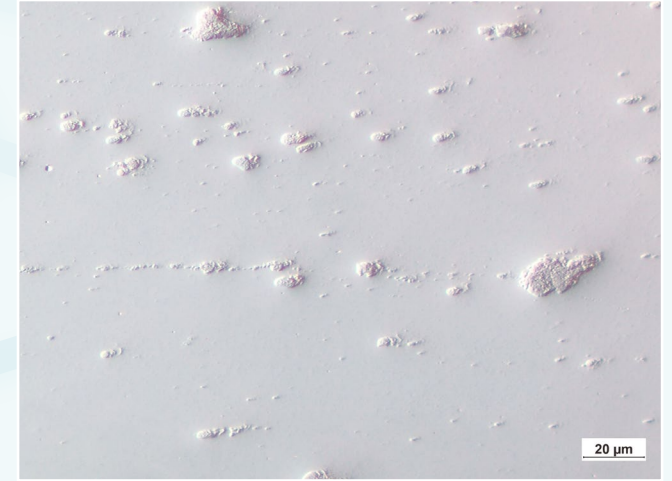
最终制样结果



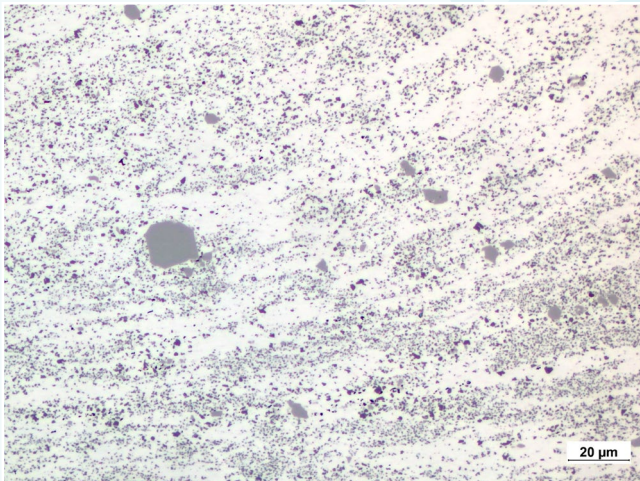
A12024, 明场像, 100倍



A12024, 微干涉衬度像, 200倍



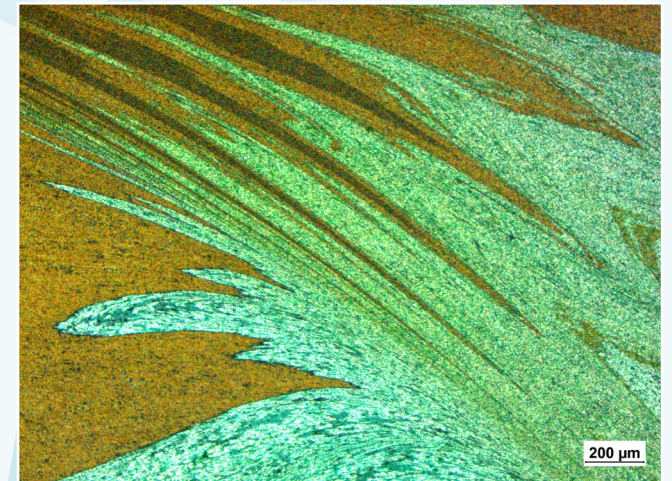
A12024, 微分干涉衬度像, 500倍



搅拌摩擦焊铝合金, 明场像, 500倍



搅拌摩擦焊铝合金, 根据Barker腐蚀, 偏正光+Lambda补偿片, 50倍



搅拌摩擦焊铝合金, 根据Barker腐蚀, 偏正光+Lambda补偿, 50倍